

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年8月11日(2005.8.11)

【公表番号】特表2001-507069(P2001-507069A)

【公表日】平成13年5月29日(2001.5.29)

【出願番号】特願平10-528865

【国際特許分類第7版】

C 0 8 F 4/64

C 0 8 F 10/00

【F I】

C 0 8 F 4/64

C 0 8 F 10/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成16年12月14日(2004.12.14)

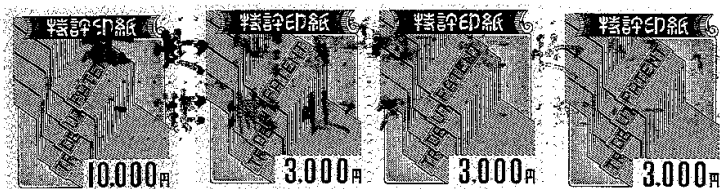
【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】補正の内容のとおり

【訂正方法】変更

【訂正の内容】



誤 訳 訂 正 書

(19,000 円) /

平成16年12月14日 /

特許庁長官 殿

1 事件の表示

平成10年特許願第528865号 /

2 特許出願人

住 所 アメリカ合衆国、テキサス州 / 77520-5200、 /

ベイタウン、ベイウエイ / ドライブ 5200 /

名 称 エクソンモービル・ケミカル・パテント・インク /

3 代 理 人

住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号

相互永田町ビルディング 8階

電話 3581-9371

氏 名 (7101) 弁理士 山 崎 行 造

4 訂正対象書類名

明細書

5 訂正対象項目名

明細書

6 訂正の内容

別紙の通り

7 訂正の理由

別紙の通り



[誤訳訂正 1]

明細書 2 頁 15 行「0. 9 2 2 2 の」を「0. 9 2 2 2 g / c c の」に訂正する。

[誤訳訂正 2]

明細書 9 頁下から 2 行「ヒドロカルビル置換カルコゲン基」を「C₁-C₂₀ヒドロカルビル置換カルコゲン基」に訂正する。

[誤訳訂正 3]

明細書 18 頁 18 行「メタロセンハリド共に」を「メタロセンハリドと共に」に訂正する。

[誤訳訂正 4]

明細書 22 頁下から 5 行「エチレンポリマー」を「エチレンポリマーを含む」に訂正する。

[誤訳訂正 5]

明細書 23 頁 12 行「接触させない上で定義した」を「接触させない、上で定義した」に訂正する。

[誤訳訂正 6]

明細書 24 頁 14 行「混合されてはならない。」を「混同してはならない。」に訂正する。

[誤訳訂正 7]

明細書 25 頁 17 行「乾燥固体生成物」を「乾燥固体混合物」に訂正する。

[誤訳訂正 8]

明細書 27 頁下から 2 行「窒素吸着用」を「窒素吸収用」に訂正する。

[誤訳訂正 9]

明細書 30 頁 9 行「反応床」を「反応器床」に訂正する。

[誤訳訂正 10]

明細書 30 頁下から 10 行「気体空筒速度」を「気体空塔速度」に訂正する。

[訂正の理由等]

(訂正の理由 1)

誤訳訂正 1 による訂正は P C T 出願明細書 2 頁 2 5 行の “g/cc” の訳の脱落を加入するための補正である。

(訂正の理由 2)

誤訳訂正 2 による訂正は P C T 出願明細書 1 0 頁 2 8 行の “ C_1-C_{20} ” の訳の脱落を加入するための補正である。

(訂正の理由 3)

誤訳訂正 3 による訂正は誤訳の訂正ではなく、誤記の訂正である。

(訂正の理由 4)

誤訳訂正 4 による訂正は P C T 出願明細書 2 2 頁 2 5 行の “include” の訳の脱落を加入するための補正である。

(訂正の理由 5)

誤訳訂正 5 による訂正は誤訳の訂正ではなく、訳をわかりやすくするための補正である。

(訂正の理由 6)

誤訳訂正 6 による訂正は P C T 出願明細書 2 4 頁 1 1 行の “be confused” の誤訳を訂正する補正である。

(訂正の理由 7)

誤訳訂正 7 による訂正は P C T 出願明細書 2 5 頁 2 3 行の “dry solid mixture” の訳を訂正する補正である。

(訂正の理由 8)

誤訳訂正 8 による訂正は P C T 出願明細書 2 8 頁 1 6 行の “absorption” の誤訳を訂正する補正である。

(訂正の理由 9)

誤訳訂正 9 による訂正は P C T 出願明細書 3 1 頁 8 行の “reactor bed” の誤訳を訂正する補正である。

(訂正の理由 1 0)

誤訳訂正 1 0 による訂正は P C T 出願明細書 3 1 頁 2 3 行の “superficial gas velocity” の訳の誤植を訂正する補正である。